別記様式第２号

|  |  |
| --- | --- |
| 整理番号 |  |

装置開発室装置利用申請書（ナノプラット事業成果公開）

　　年　　月　　日

分子科学研究所長　殿

|  |  |
| --- | --- |
| 所属 | 住所（〒　　　　　） |
| 職名 | 電話 |
| ふりがな | ＦＡＸ |
| 氏名 | e-mail |
| 企業種別(＊)：　大企業　　中小企業　　その他 | 分野・業種等(＊)： |

＊・・・本様式末尾記載の基準及び一覧から選択すること

下記のとおり貴研究所の装置を有償利用したいので申請します。

また，実施に当たって，万一の傷害等の保障に関しては，申請者と申請者の所属機関においてすべての責任を負うことを誓約します。

記

１．研究課題名：

２．利用を希望する設備と利用期間

マイクロストラクチャー　　□　３次元光学プロファイラー ZYGO NexView

製作・評価支援：　□　マスクレス露光装置 NanoSystem Solutions DL-1000

　　　　　　　　　　　　　　　（付属装置）スピンコーター ﾐｶｻ MS-A100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マスクアライナー ﾐｶｻ MA-10

　　　利用期間：　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日

　　　利用日数及び時間数：　　　日間（　　時間）

　　　※利用期間は１か月以内とすること。

　　　※利用日数及び時間数（見込み）については、最大の数字を記入すること。

３．放射線業務に従事することの有無　　　　□有　　　　　　　□無

　（注）有の場合は「放射線業務従事承認書」を提出してください。）

４．　研究目的と実施計画：

各項目についてＡ４判縦１枚（２ページ）に入るように記述し，添付してください。

１）研究目的（500～1000字程度）

分子科学における当研究の意義付けを含めて，平易かつ簡潔に記載してください。

継続して申請する場合，これまでの研究経緯と本研究で新規に目指す内容について具体的に記載して

ください。

２）研究の実施計画（1000字～2000字程度）

この研究を分子科学研究所で実施することの必要性を含めて，具体的に記入してください。

５．研究実験補助のために共同利用研究者を伴う場合，氏名，所属及び職名

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 氏名 | 所属 | 職名 |
| 申請者 |  |  |  |
| １ |  |  |  |
| ２ |  |  |  |
| ３ |  |  |  |
| ４ |  |  |  |
| ５ |  |  |  |

同伴者は５名まで可能です。申請者のほかに共同利用研究者に含める同伴者を記入してください。

６．不正防止に関する誓約

　　申請者及び共同利用研究者は、貴研究所の装置の有償利用にあたり、以下のガイドライン等を理解し、これらのガイドライン・方針・規程、自身が所属する機関の規則、関連する法令等を遵守し、研究活動における特定不正行為（捏造、改ざん、盗用）、及びそれ以外の不正行為（不適切なオーサーシップ、二重投稿等）を行いません。

　（１）研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン

（平成２６年８月２６日文部科学大臣決定）

　　　http://www.mext.go.jp/b\_menu/houdou/26/08/\_\_icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568\_02\_1.pdf

　（２）大学共同利用機関法人自然科学研究機構研究活動上の不正行為を防止するための基本方針

　　　（平成２０年２月２８日決定）

https://www.nins.jp/site/rule/1024.html

　（３）大学共同利用機関法人自然科学研究機構における研究活動上の不正行為への対応に関する規程（平成２０年２月２８日自機規程第７４号）

　　　https://www.nins.jp/uploaded/attachment/3157.pdf

　　以上について、誓約する場合はチェックを入れてください。

**□　誓約します。**

７．安全管理に関する誓約

　　申請者及び共同利用研究者は、貴研究所の装置の有償利用にあたり、分子科学研究所安全ガイド（https://www.ims.ac.jp/guide/safetyguide.pdf）を理解し、これらのガイドライン、自身が所属する機関の規則、労働安全衛生法等の関連する法令等を遵守し、安全と環境を常に意識しながら、研究活動における事故・災害の発生防止に努めます。

　　以上について、誓約する場合はチェックを入れてください。

**□　誓約します。**

上記の装置利用の申込みを承認する。

　所　属：

　職　名：

氏　名：

　上記は，申請者が本研究所に来所し実験等を行うことを

承認できる方の所属，職名及び氏名(申請者本人は不可)を

記入の上，捺印ください。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 記載不要 | ﾅﾉﾌﾟﾗｯﾄ事業  実施責任者 | 装置開発室長 | 担当者 |
|  |  |  |

【企業種別基準】

大企業　　資本金３億円以上または従業員３００人以上のどちらかに該当するもの

中小企業　資本金３億円以上または従業員３００人以上のどちらにも該当しないもの

その他　　上記に該当しないもの

【分野・業種等一覧】

１　有機材料／２　電子・磁性・金属・無機材料／３　繊維・窯業・紙・パルプ　／４　食品・飲料／５　化粧品・トイレタリー／６　医療・医薬品／７　精密機器・産業機械製造業／８　医療機器製造業／９　分析・計測機器／１０　電気・電子機器・総合電機／１１　半導体・電子部品製造業／１２　自動車・輸送・運輸機器・部品製造業／１３　鉄鋼・非鉄金属製造業／１４　商社・代理店・流通・小売業／１５　電力・ガス・石油・その他エネルギー／１６　建設・不動産／１７　情報・通信／１８　金融・投資・コンサルティング／１９　シンクタンク／２０　水産・農林・鉱業／２１　報道・メディア・出版／２２　外国公館・機関・団体／２３　官公庁・自治体・地方公共団体／２４　教育・研究機関／２５　その他